

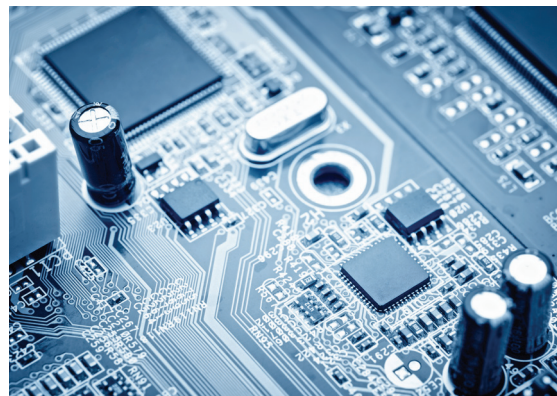
半導体グレード試薬 ニーズに応える超高純度

高純度化学薬品や試薬の製造と精製における30年以上に渡る経験を生かし、ハネウェルはエレクトロニクスおよび半導体産業向けの包括的なポートフォリオを展開しています。当社の豊富な製品ベースには十分な実績があり、世界トップクラスのエレクトロニクスメーカーで大量に使用されてきました。

当社の高純度化学薬品は、教育、リサーチ、開発、ハイテクマイクロ/ナノチップのプロトタイプ作成や小規模生産に携わる研究者向けに特殊設計された小型パッケージサイズで提供されています。

半導体グレード製品には高性能アプリケーション向けの高純度製品もご用意しています：

- **エッチング液** 酸/アルカリ、フッ化アンモニウム、過酸化水素などを使用するウェットエッチングのプロセス用
- **ヘキサメチルジシラザン (HMDS)** シリコンウェハ表面のシラン処理に使用。
- **溶剤** 極低レベルの金属濃度で、溶剤機器の洗浄、ウェハの乾燥、基板堆積や基板除去などに広く使用。



特徴

- 高純度、安定性、非常に優れたロット間の恒常性
- ISO 9001およびRC 14001認証

容器




- 1L ガラス瓶
- 2.5L プラスチックボトル および 5Lプラスチック缶
- 5kg プラスチックボトル

含まれる化学薬品

- 酸
- アルカリ
- 溶媒
- 他のエレクトロニクス品用化学薬品



製品番号	製品名	パッケージ
酸/アルカリ		
40291H	水酸化アンモニウム溶液、H ₂ O中にNH ₃ ≥25%、VLSIグレード	2.5 L
40253H	塩酸、発煙37%	2.5 L
40233H	塩酸、≥32%	2.5 L
40213H	フッ化水素酸、49.5～50.5%	5 L
40222H	硝酸、≥69%	2.5 L
40230H	硝酸、≥65%	2.5 L
40303H	硝酸、69-71%、VLSIグレード	2.5 L
40266H	リン酸、≥85%	2.5 L
40216H	水酸化カリウム	5 kg
40254H	硫酸、95～97%	2.5 L
溶媒		
40289H	アセトン、≥99.5%、USLIグレード	2.5 L
40296H	メタノール、≥99.9% VLSIグレード	5 L
40219H	2-プロパノール、≥99.8%	5 L
40301H	2-プロパノール、≥99.8% VLSIグレード	2.5 L, 5 L
その他のエレクトロニクス用化学薬品		
40207H	フッ化アンモニウム - フッ化水素酸混合物、AF875-125、エッチング混合物	2.5 L
40208H	フッ化アンモニウム溶液、≥40%	5 L
40292H	フッ化アンモニウム溶液、≥40% VLSIグレード	5 L
40215H	ヘキサメチルジシラザン (HMDS)、≥98%	1 L
40267H	過酸化水素溶液、≥30%	5 L

-  氏名を入力
-  Eメールを入力
-  電話番号を入力

詳しい情報は

Lab-honeywell.com

ハネウェル・スペシャルティ・ケミカルズ Seelze GmbH

Wunstorfer Strasse 40
D-30926 Seelze, Germany

ハネウェルジャパン株式会社

Honeywell Japan Inc.
〒105-0022
東京都港区海岸1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワー 20F
Tel: 03-6730-7000 (代表)

本文中で提供されるすべての記述と情報は正確で信頼できるものと信じられていますが、明示的あるいは黙示的のいずれかを問わず、いかなる種類のものであれ、品質や安全性の保証、権利保証、あるいは責任を一切伴わずに公開されるものです。当社製品について考えられる使用方法に関するいずれの記述や提案も、特許侵害の可能性に関する何らかの表明や保障なしに提供されており、何らかの特許を侵害することを推奨するものでもありません。ユーザーは全ての安全措置が本文書に示唆されている、あるいは他の手段が必要ではないと考えるべきではありません。この情報の使用および生じる結果に関する全ての責任はユーザーが自ら引き受けるものとします。



2057-RC-A4-ENG-V1-2017年11月
© 2017 Honeywell International Inc. 全権留保

Honeywell